

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成23年9月15日(2011.9.15)

【公表番号】特表2009-544489(P2009-544489A)

【公表日】平成21年12月17日(2009.12.17)

【年通号数】公開・登録公報2009-050

【出願番号】特願2009-520792(P2009-520792)

【国際特許分類】

B 4 1 J 2/05 (2006.01)

B 4 1 J 2/16 (2006.01)

【F I】

B 4 1 J 3/04 103B

B 4 1 J 3/04 103H

【手続補正書】

【提出日】平成22年7月6日(2010.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面を有する多結晶シリコン基板であって、一部が液体チャネルを定める多結晶シリコン基板と、

該多結晶シリコン基板の前記表面に配置されたノズル板構造であって、一部がノズルを定め、該ノズルは、前記液体チャネルと流体連通される、ノズル板構造と、

該ノズル板構造と対応する液滴形成機構であって、制御可能に作動し、前記ノズルを通って流れる連続液体ストリームから、液滴を形成し、または前記ノズルに存在する液体から、オンデマンド式に液滴を放出する液滴形成機構と、

を有するプリントヘッド。

【請求項2】

プリントヘッドを形成する方法であって、

多結晶シリコン基板を提供するステップと、

前記多結晶シリコン基板の表面で、処理プロセスを実施するステップと、

前記多結晶シリコン基板の前記表面に、ノズル板構造を提供するステップと、

前記ノズル板構造と対応する液滴形成機構を提供するステップと、

を有する方法。

【請求項3】

多結晶基板装置であって、

第1の結晶および第2の結晶を有する基板であって、前記第1の結晶は、前記第2の結晶の配向とは異なる配向を有する、基板と、

前記第1の結晶の少なくとも一部に配置された第1のホールと、

前記第2の結晶の少なくとも一部に配置された第2のホールと、

を有する多結晶基板装置。